



CAPITULO 3

Aula 13

Conceitos básicos de dispositivos semicondutores: silício dopado, mecanismos de condução (difusão e deriva), exercícios.
(Cap. 3 p. 117-121)

Eletrônica I – PSI3321

Aula	Matéria	Cap./pág.	Testes agendados
1 ^a 22/03	Introdução, O primeiro Amp Op Comercial. Encapsulamento do Amp Op, O Amp Op ideal, Análise de circuitos com Amp Ops ideais. Exemplo 2.2	Cap. 2 p. 38-46	
2 ^a 25/03	Somador, Configuração não inversora, seguidor, amplificador de diferenças. Exercício 2.15	Sedra, Cap. 2 p. 46-53	
3 ^a 29/03	Amplificador de instrumentação, Funcionamento dos Amp Ops Não-Ideais. Exemplo 2.3 e 2.4	Sedra, Cap. 2 p. 53-59	Teste 01 9h20-9h40
4 ^a 01/04	Operação dos Amp Ops em grande excursão de sinal, imperfeições cc, circuitos integrador e diferenciador. Exemplo 2.6.	Sedra, Cap. 2 p. 59-73	
5 ^a 05/04	Diodo ideal, características do diodo real, equação de corrente do diodo, exercícios.	Sedra, Cap. 3 p. 89-96	Teste 02 9h20-9h40
6 ^a 08/04	Análise gráfica (reta de carga), modelos simplificados de diodos, exercícios	Sedra, Cap. 3 p. 96-99	
Semana Santa (11/04 a 16/04/2022)			
7 ^a 19/04	Modelo para pequenos sinais, modelos de circuitos equivalentes para pequenas variações (próximas do ponto quiescente), exercícios (exemplos 3.6 e 3.7)	Sedra, Cap. 3 p. 100-103	Teste 03 9h20-9h40
8 ^a 26/04	Operação na região de ruptura reversa, diodo zener, Projeto de um regulador Zener, exercícios (exemplo 3.8)	Sedra, Cap. 3 p. 104-106	Teste 04 9h20-9h40
9 ^a 29/04	Diagrama de blocos de uma fonte de alimentação c.c., circuito retificador de meia onda, circuito retificador de onda completa com enrolamento secundário com tomada central, exercícios: 3.22.	Sedra, Cap. 3 p. 106-109	
10 ^a 03/05	Circuito retificador em ponte. Circuito retificador de meia onda com o capacitor de filtro.	Sedra, Cap. 3 p. 109-111	Teste 05 9h20-9h40
11 ^a 06/05	Retificador de onda completa com capacitor de filtro, superdiodo. Exercícios (exemplo 3.9).	Sedra, Cap. 3 p. 112-115	
12 ^a 10/05	Circuitos limitadores, circuitos grampeadores, dobrador de tensão, exercícios: 3.27, 3.28	Sedra, Cap. 3 p. 115-118	Teste 06 9h20-9h40
13 ^a 13/05	Conceitos básicos de dispositivos semicondutores: silício dopado, mecanismos de condução (difusão e deriva), exercícios.	Aula avulsa + Sedra, Cap. 3 p. 117-121	
1º. Semana de Provas (16/05 a 20/05/2022)			
Data: xx/xx/2022 (xxxx-feira) – Horário: xx:xxh			

14ª Aula:

Silício dopado, mecanismos de condução (difusão e deriva)

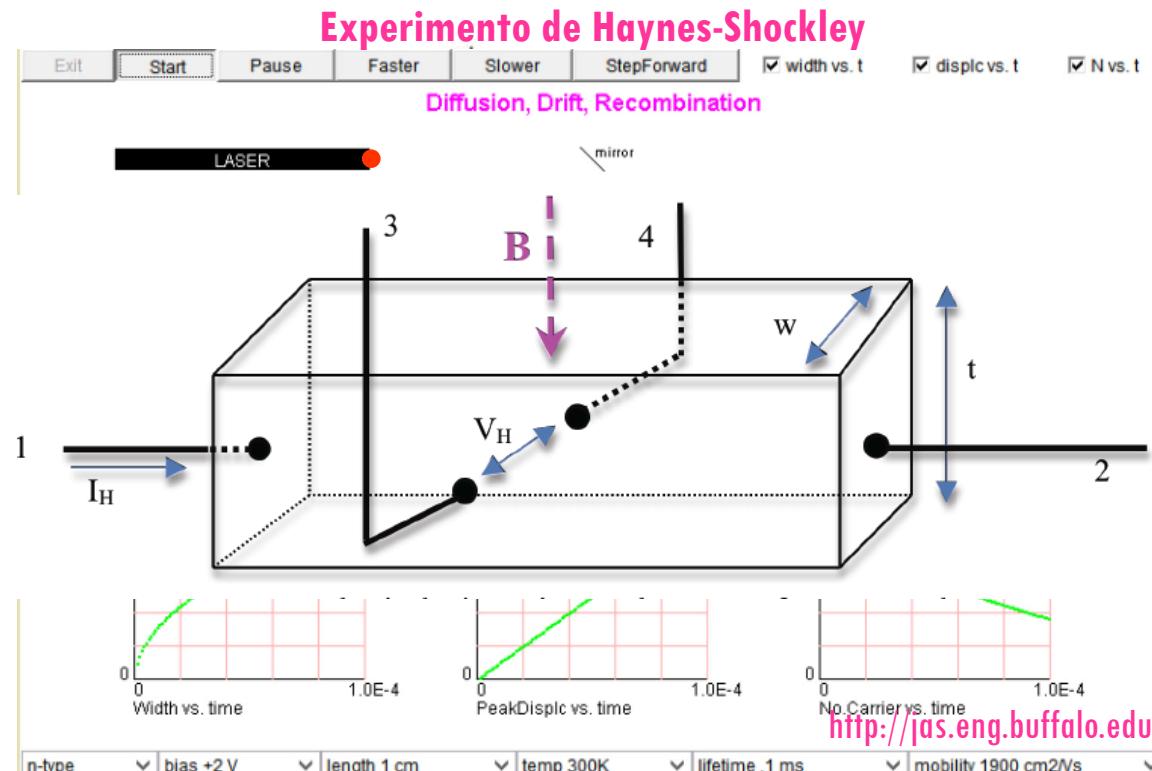
Ao final desta aula você deverá estar apto a:

- Descrever os principais mecanismos de geração de corrente elétrica em um material semicondutor
- Apresentar a estrutura cristalina 3D e sua representação 2D, dando uma ordem de grandeza das dimensões envolvidas
- Explicar a existência de elétrons livres na estrutura e o conceito de lacunas (buracos)
- Calcular a concentração intrínseca de portadores livres
- Explicar as consequências da dopagem de materiais semicondutores
- Olhar a Lei de Ohm do lado de dentro do material, explicando os conceitos de condutividade e mobilidade

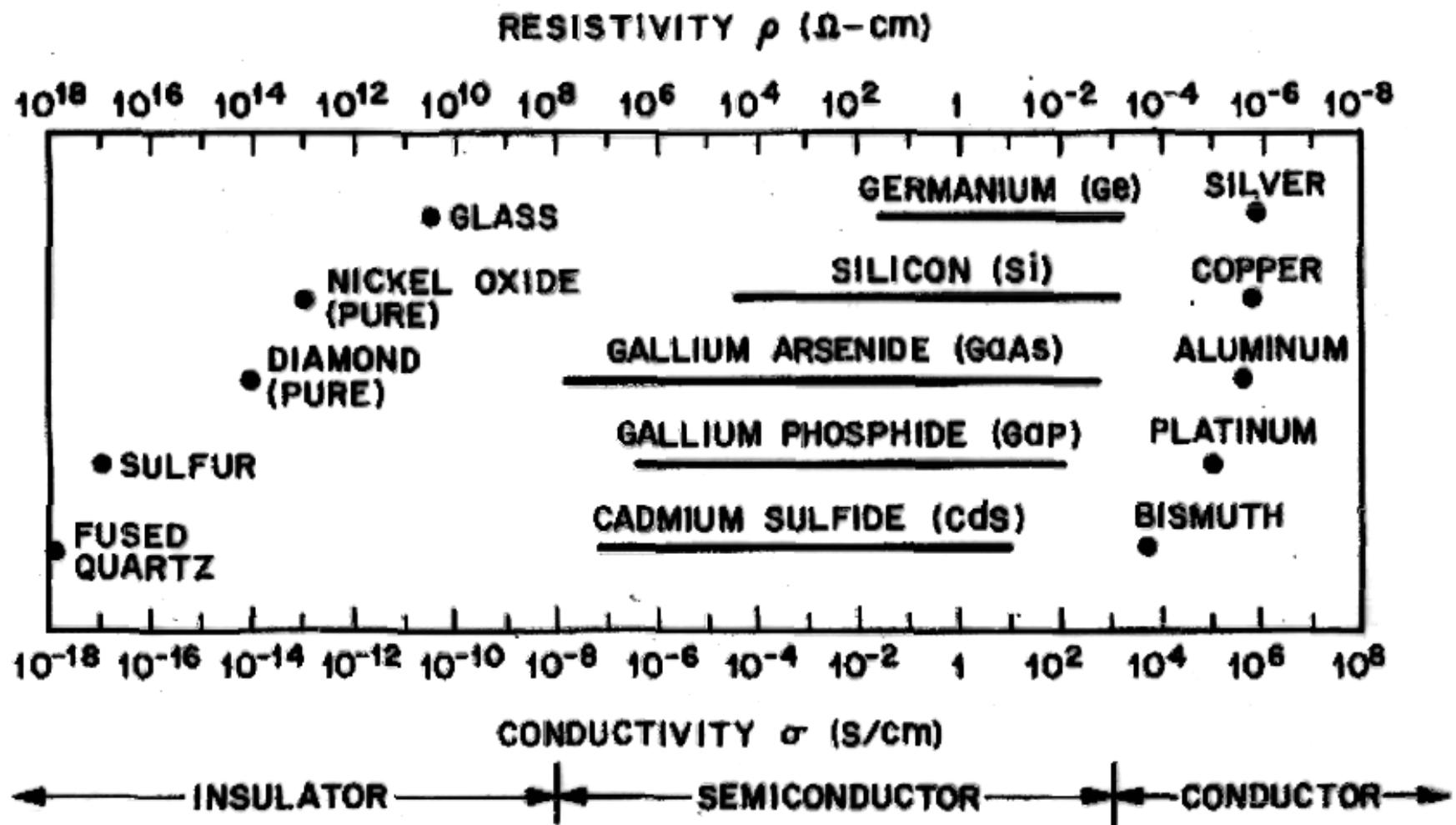
Materiais para Eletrônica

A resistividade de um semicondutor é sensível à:

- Temperatura
- Iluminação
- Campos magnéticos
- Pequenas doses de impurezas



Materiais para Eletrônica (pequenas doses de impurezas)



Estrutura Cristalina

Os materiais semicondutores são encontrados na forma cristalina, policristalina e amorfa.

Estudaremos basicamente os materiais semicondutores na forma cristalina:

- Os átomos estão arranjados de uma forma periódica tridimensional
- A esse arranjo chamaremos de rede cristalina

Materiais para Semicondutores

Lanthanides

Actinides

Materiais para Semicondutores

Table 1 Portion of the Periodic Table Related to Semiconductors

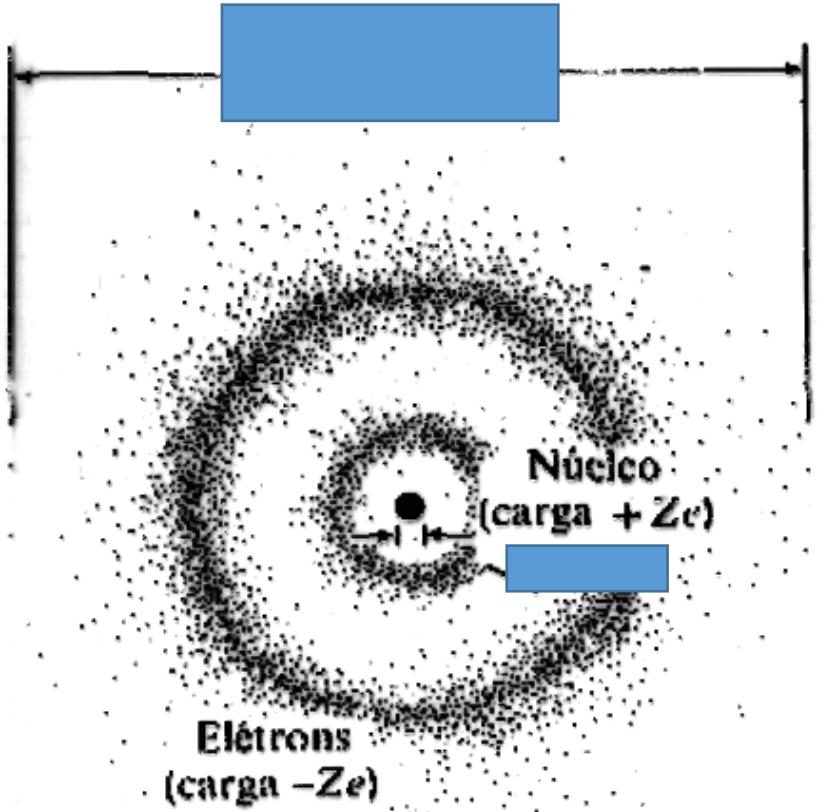
Period	Column II	III	IV	V	VI
2		B Boron	C Carbon	N Nitrogen	
3	Mg Magnesium	Al Aluminum	Si Silicon	P Phosphorus	S Sulfur
4	Zn Zinc	Ga Gallium	Ge Germanium	As Arsenic	Se Selenium
5	Cd Cadmium	In Indium	Sn Tin	Sb Antimony	Te Tellurium
6	Hg Mercury		Pb Lead		

Materiais para Semicondutores

Table 2 Element and Compound Semiconductors

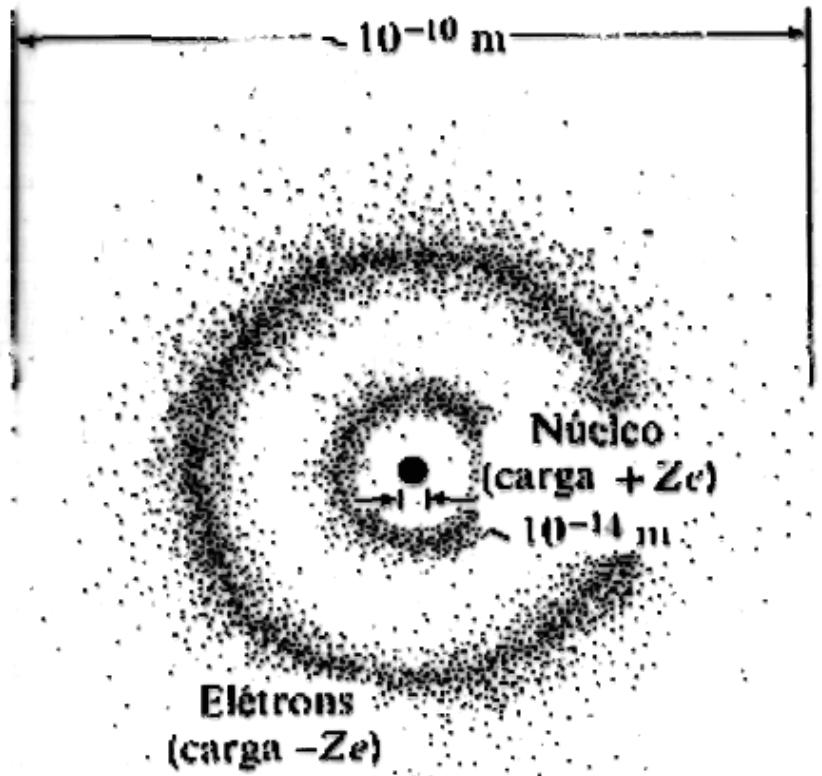
Element	IV–IV Compounds	III–V Compounds	II–VI Compounds	IV–VI Compounds
Si	SiC	AlAs	CdS	PbS
Ge		AlSb	CdSe	PbTe
		BN	CdTe	
		GaAs	ZnS	
		GaP	ZnSe	
		GaSb	ZnTe	
		InAs		
		InP		
		InSb		

O Átomo



- Núcleo composto por nêutrons e prótons ($+q$) com massas iguais de $1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$ (1.700 vezes a massa do elétron).
- Uma nuvem de elétrons recobre o núcleo
- O átomo é eletricamente neutro

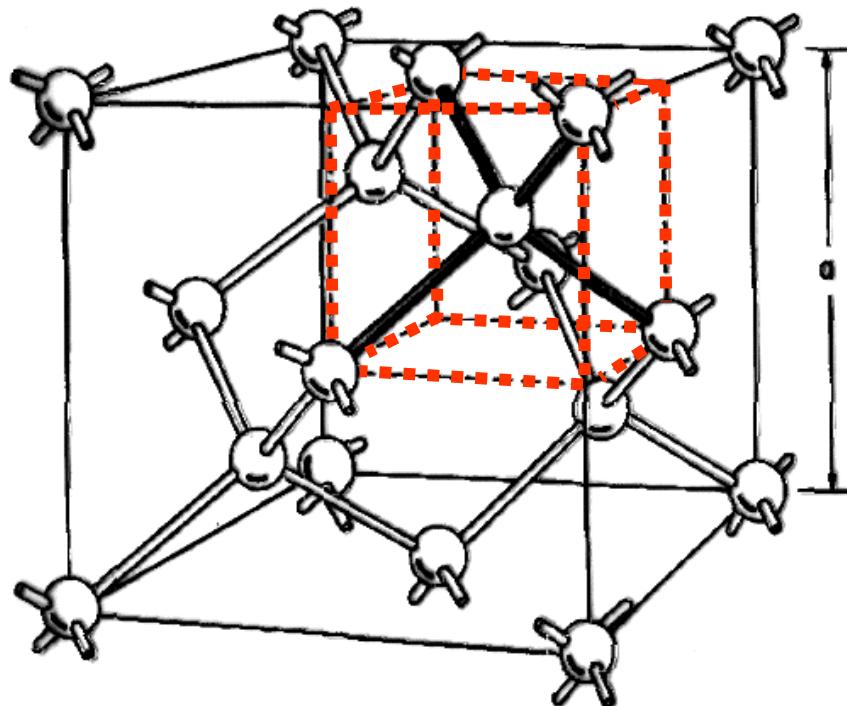
O Átomo



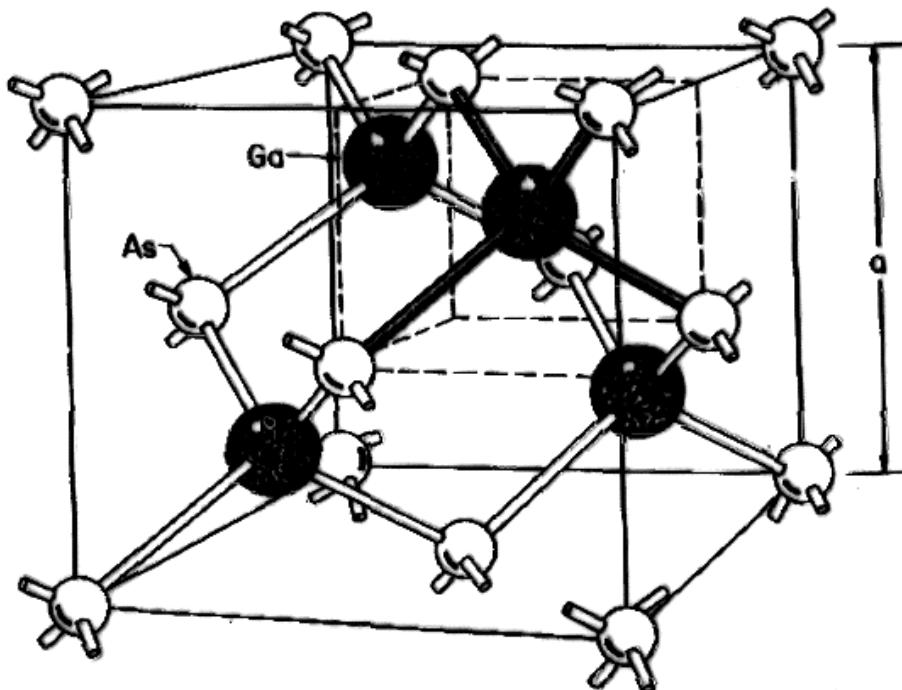
- Núcleo composto por nêutrons e prótons ($+q$) com massas iguais de $1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$ (1.700 vezes a massa do elétron). **O núcleo tem diâmetro de $\sim 10^{-14} \text{ cm}$**
- Uma nuvem de elétrons recobre o núcleo, **estendendo-se até $\sim 10^{-10} \text{ cm}$**
- O átomo é eletricamente neutro

Estrutura Cristalina

A estrutura do diamante (e dos principais materiais semicondutores)

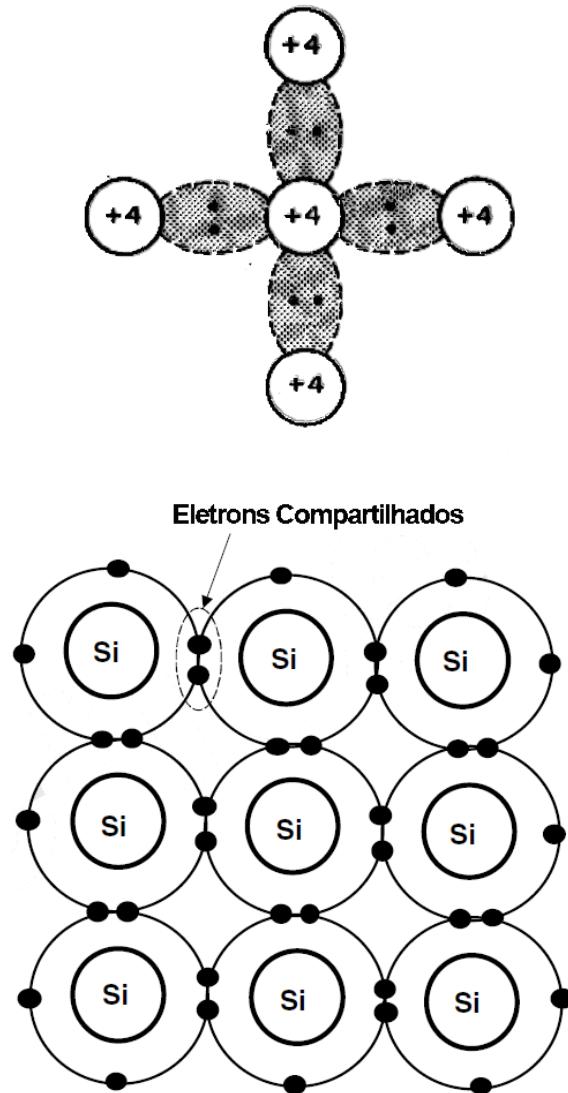
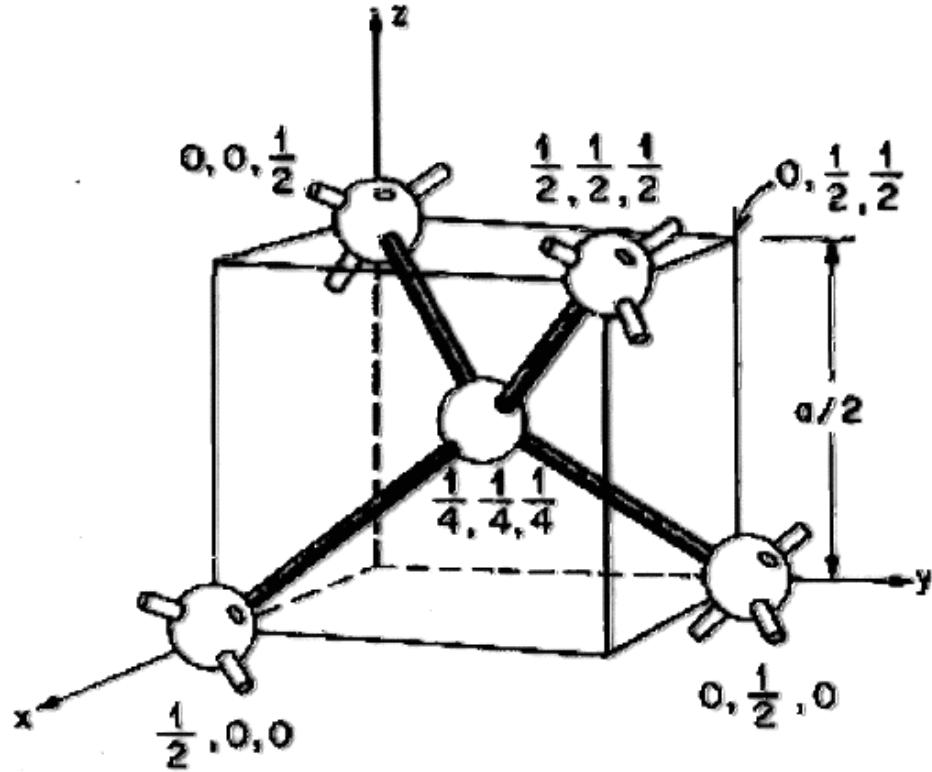


Silício ($a = 5,43 \text{ \AA}$)

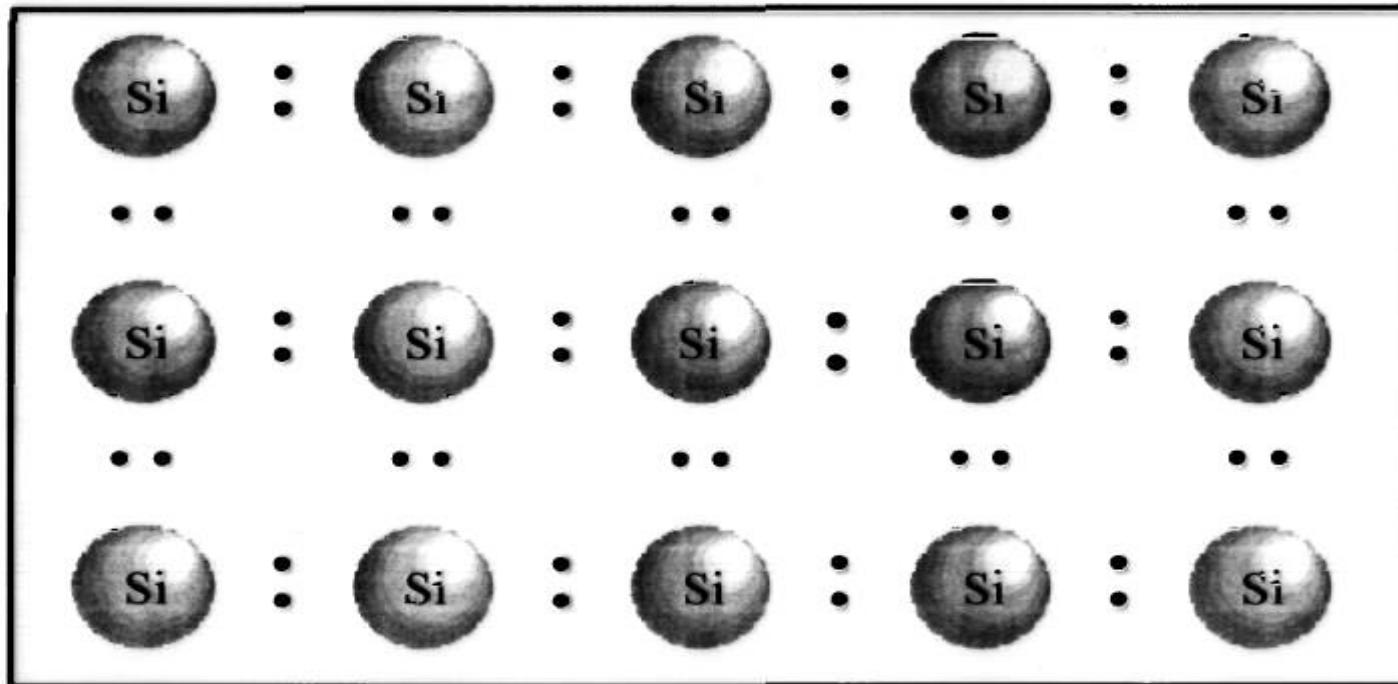


GaAs ($a = 5,63 \text{ \AA}$)

Estrutura Cristalina do Silício

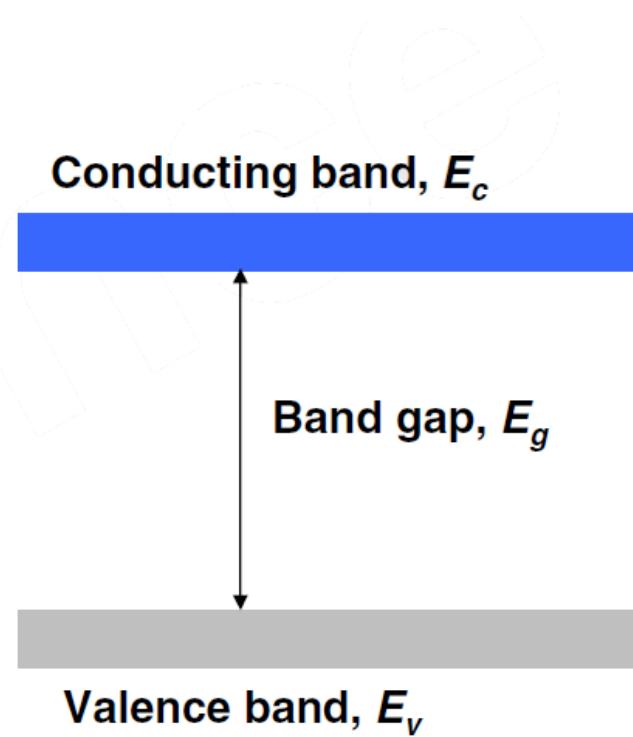
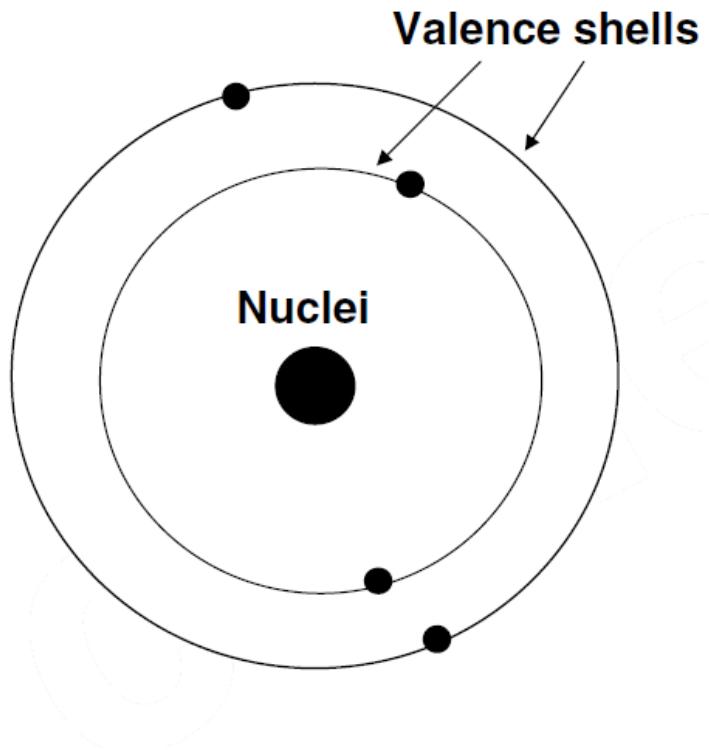


Utilizando uma representação bidimensional (simplificação),
cada átomo de silício (4 elétrons na última camada) precisa
de 4 ligações covalentes (4 átomos de Si) para atingir a estabilidade.



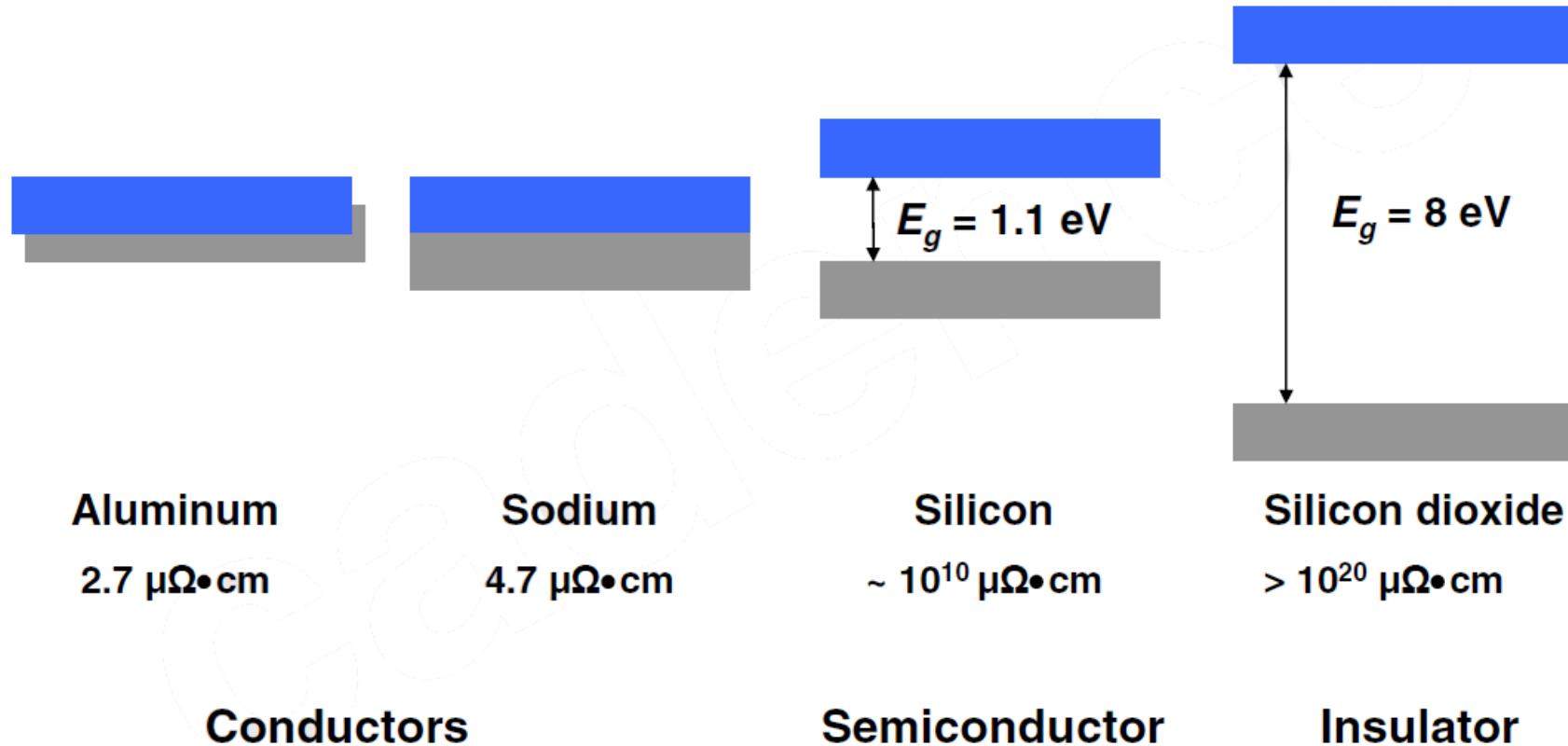
Em 0 Kelvin todos os elétrons estão presos em suas ligações covalentes

A Interpretação da Física de Estado Sólido

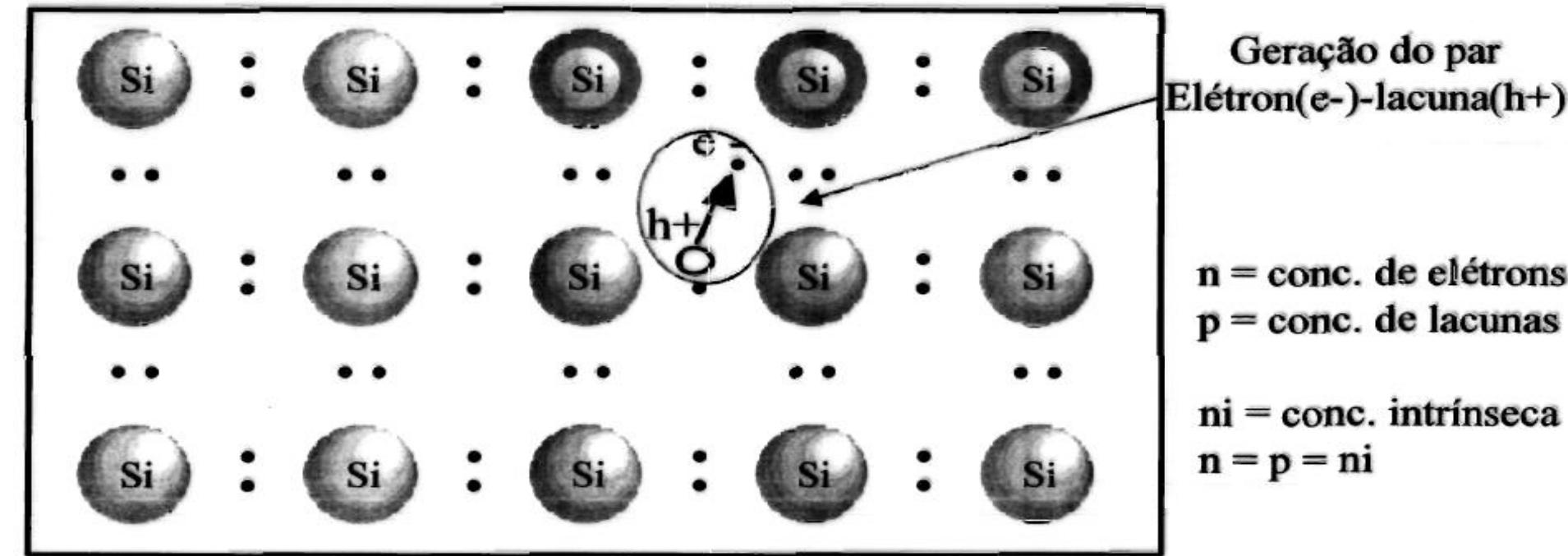


A Interpretação da Física de Estado Sólido

Porque um material é condutor, semicondutor ou isolante?



Em temperatura maior que 0 K (temperatura ambiente, por exemplo, $T = 300\text{ K}$), elétrons podem adquirir energia suficiente (ionização térmica) para escapar da ligação covalente.



Neste processo, chamado de Geração de portadores, o elétron torna-se livre e deixa no seu lugar um buraco (lacuna) que também apresentará característica de portador de corrente.

Concentração Intrínseca

$$n_i(T) = [B \cdot T^3 \cdot e^{-E_g/kT}]^{1/2}$$

- **B = parâmetro que depende do material**
($B = 5,4 \times 10^{31} /K^3 \cdot cm^3$ para o silício)
- **T = temperatura em Kelvin**
- **E_g = Energia mínima para quebrar uma ligação covalente**
(1,12 eV para o silício)
- **K = $8,62 \cdot 10^{-5}$ eV/K**

Para $T = 300K$ qual o valor de n_i em cm^{-3} ?

Qual a densidade de átomos no silício monocristalino em cm^{-3} ?

Concentração Intrínseca

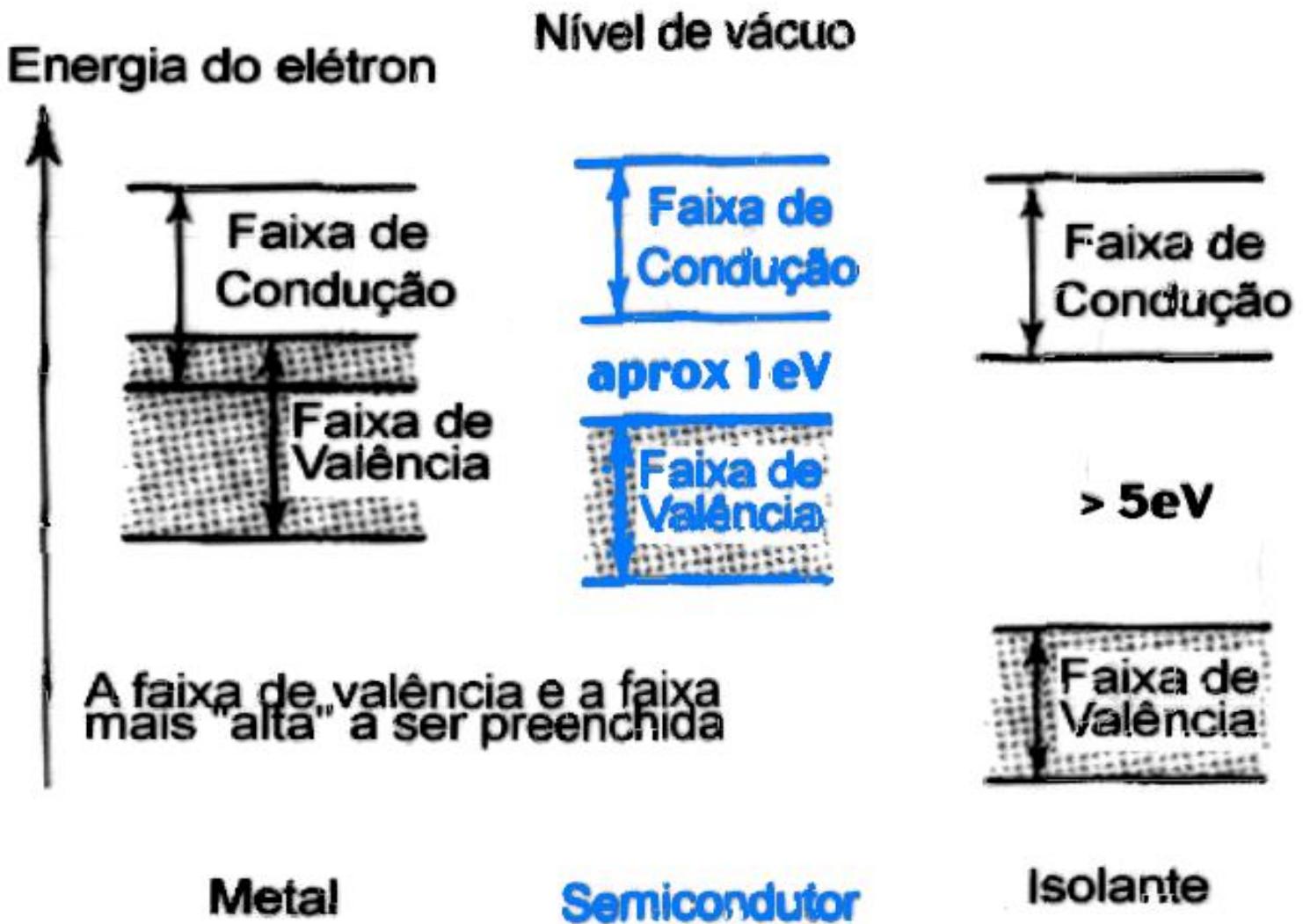
$$n_i(T) = [B \cdot T^3 \cdot e^{-E_G/kT}]^{1/2}$$

- B = parâmetro que depende do material
($B = 5,4 \times 10^{31} /K^3 \cdot cm^3$ para o silício)
- T = temperatura em Kelvin
- E_G = Energia mínima para quebrar uma ligação covalente
(1,12 eV para o silício)
- $K = 8,62 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}$

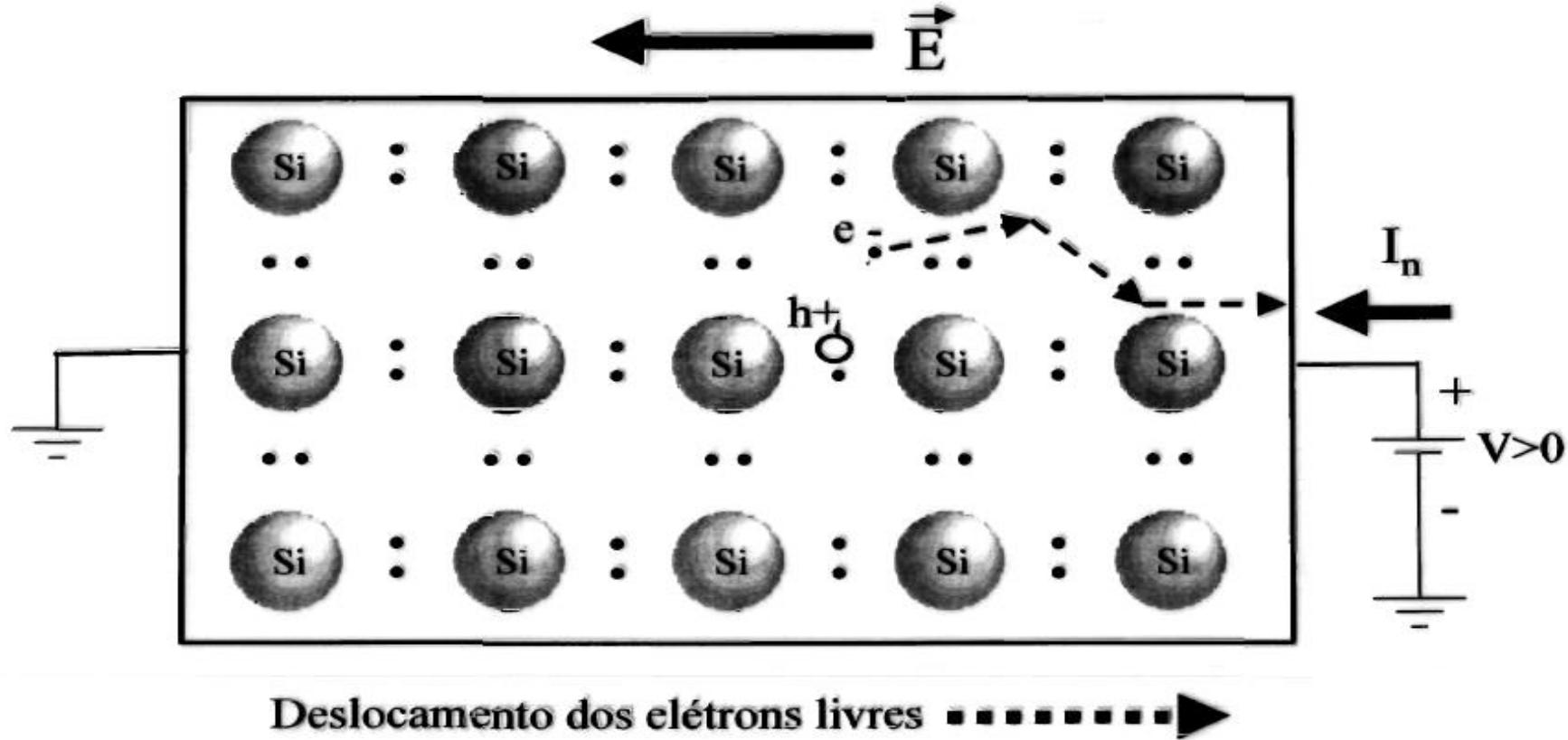
Exemplo: Para $T = 300 \text{ K} \rightarrow n_i = 1,45 \cdot 10^{10} \text{ portadores/cm}^3$, ou seja, $1,45 \cdot 10^{10} \text{ elétrons/cm}^3$ e $1,45 \cdot 10^{10} \text{ lacunas/cm}^3$, já que no silício intrínseco $n = p = n_i$

Lembrar que o silício tem $5 \cdot 10^{22} \text{ átomos de silício/cm}^3$

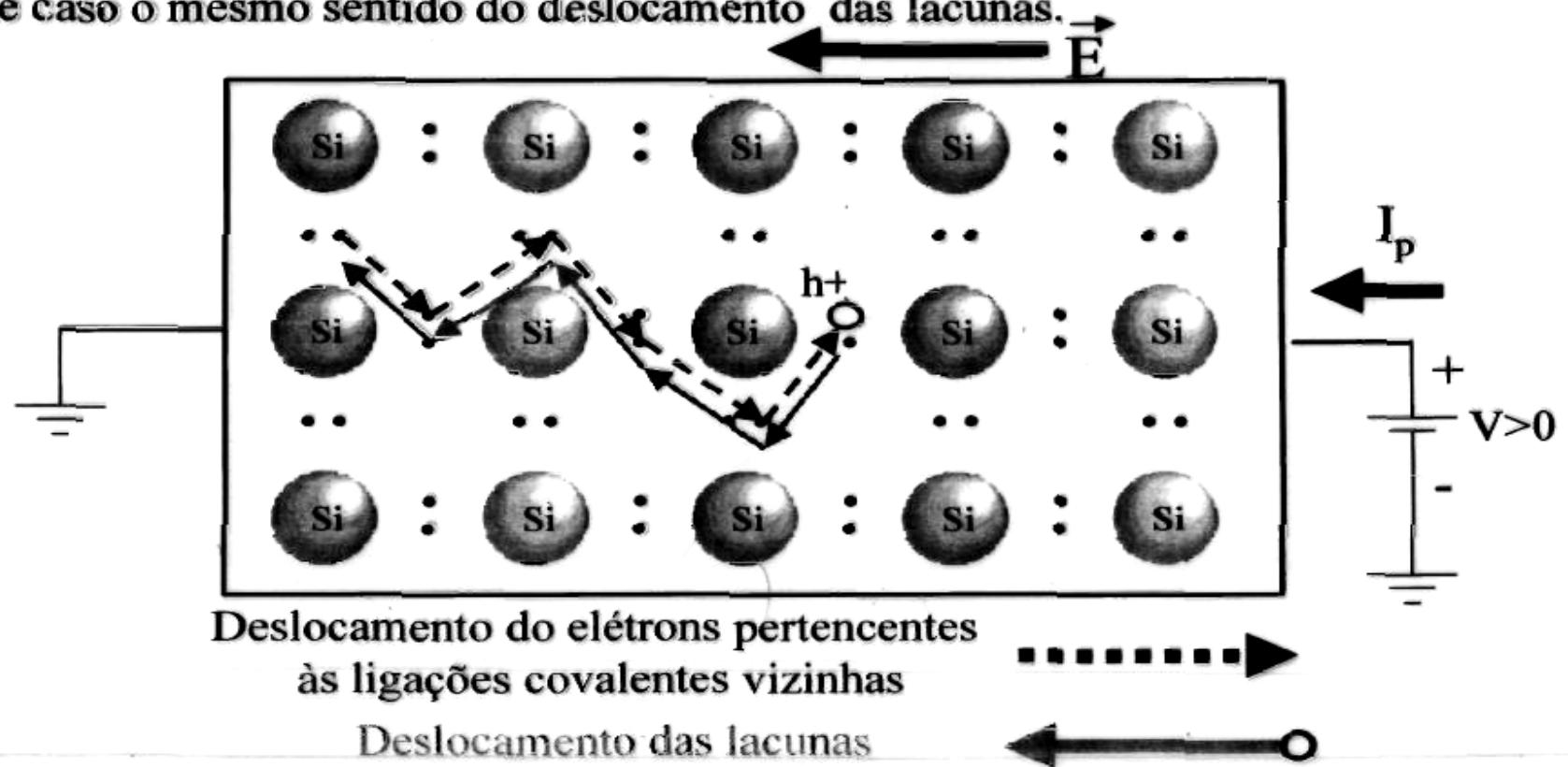
Porque um material é condutor, semicondutor ou isolante?



O elétron gerado encontra-se livre para se deslocar dentro do silício. Por exemplo, se for aplicada uma tensão como indicada abaixo, o campo elétrico induzirá o deslocamento dos elétrons no sentido inverso ao do campo elétrico. A corrente convencional associada(I_n), porém, terá o mesmo sentido do campo elétrico, como de praxe.

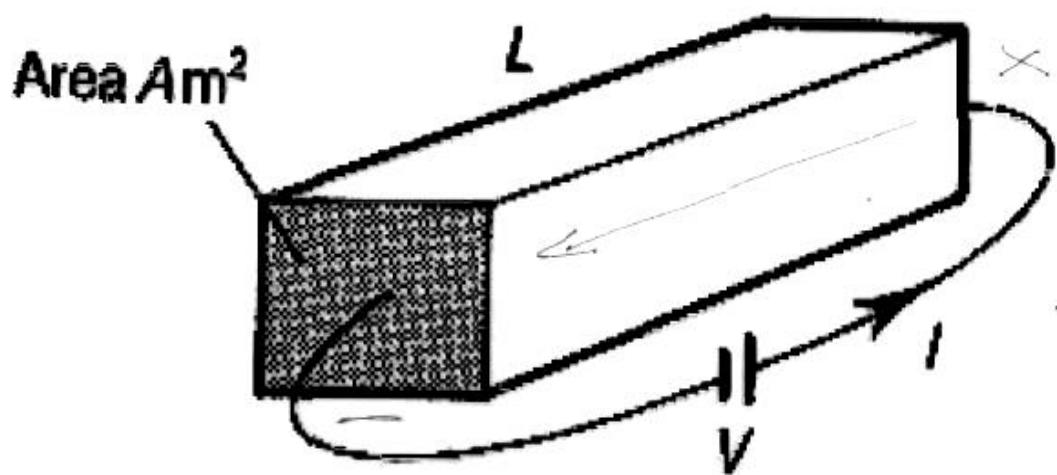


A lacuna gerada pode ser ocupada por um outro elétron vizinho (também pertencente a uma ligação covalente), que por sua vez deixará uma lacuna no seu lugar e assim sucessivamente. Por exemplo, se for aplicada uma tensão como indicada abaixo, o campo elétrico induzirá o deslocamento dos elétrons pertencentes as ligações covalentes no sentido inverso ao do campo elétrico. O processo também pode ser visto como o deslocamento de lacunas no mesmo sentido do campo elétrico, com carga positiva de carga equivalente a do elétron em módulo. A corrente convencional associada (I_p) terá neste caso o mesmo sentido do deslocamento das lacunas.



Revisitando a Lei de Ohm

Suponha uma barra de material condutor ou semicondutor homogêneo (com características uniformes) de resistividade ρ_e ($\Omega \cdot m$), comprimento L (m) e seção A (m^2), submetido a um campo elétrico E :



A corrente que circula por ele é dada por: $I = \frac{V}{R} = \frac{VA}{\rho_e L}$

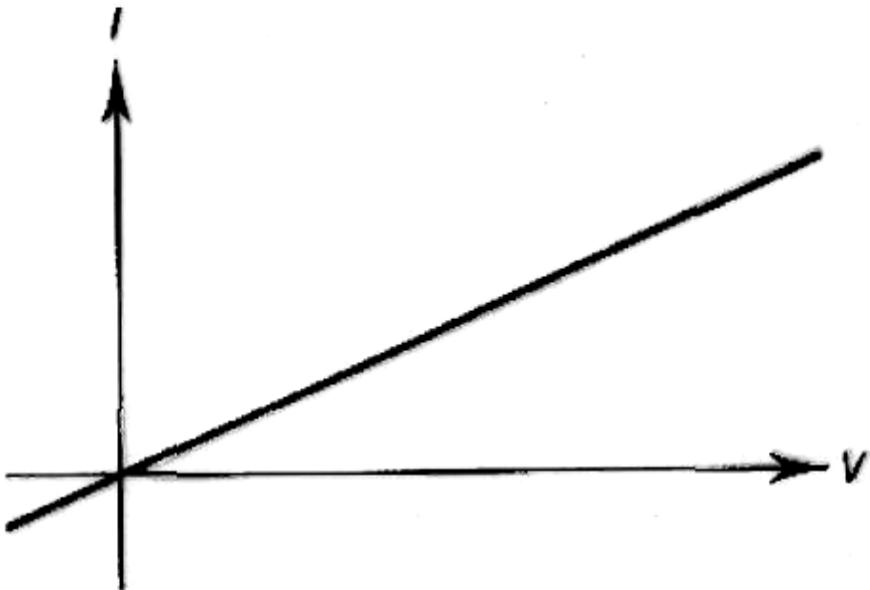
Podemos reescrever essa relação de outra forma:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{VA}{\rho_e L}$$

$$\frac{I}{A} = \frac{1}{\rho_e} \frac{V}{L} \quad [A/m^2]$$

ou

$$J = \sigma \times E \quad [A/m^2]$$



Materiais para Eletrônica

Resistividade elétrica:

$$\rho_e \text{ em } [\Omega \cdot m]$$

$\rho_e \neq \rho(z) \rightarrow$ dens. de cargas

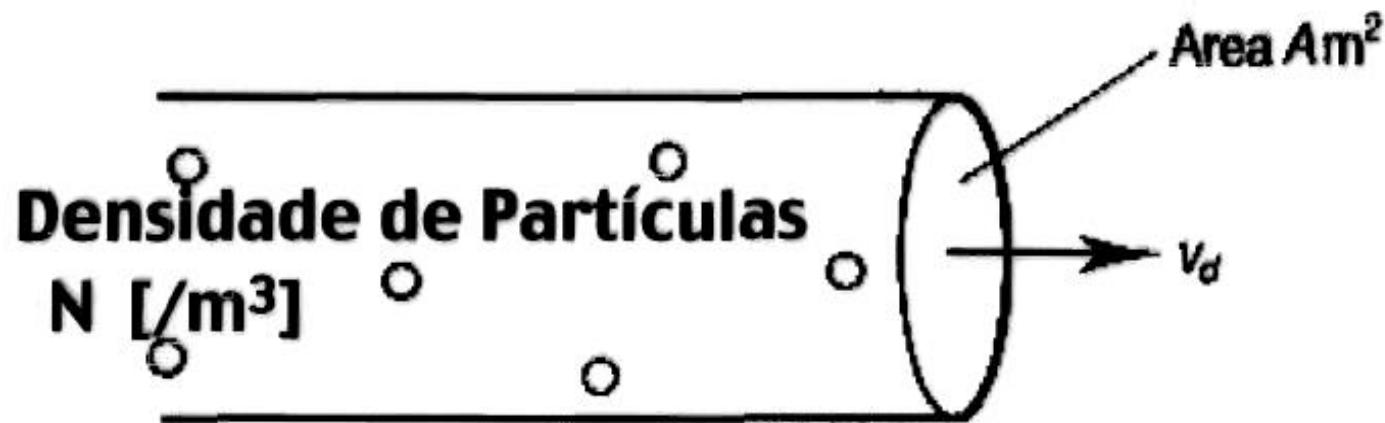
Condutividade elétrica:

$$\sigma = \frac{1}{\rho_e} \quad [1/(\Omega \cdot m)]$$

Velocidade de Deriva

I, V \leftrightarrow J, E

Vamos olhar melhor para σ :



Número de partículas em 1 m de tubo: N.A [/m]

Número de partículas em um
determinado ponto/segundo : N.A.v_d [/s]

em cargas por segundo: Q.N.A.v_d [A]

ou, em outras palavras:

$$J = Q \cdot N \cdot v_d \quad [A/m^2]$$

A velocidade v_d é conhecida como velocidade de deriva.

Elas se aplicam a qualquer material e situação onde pode-se definir uma certa densidade de partículas móveis e uma velocidade MÉDIA pode ser definida.

Condutividade e Mobilidade

Concluímos que:

$$J = \sigma \times E \quad [A/m^2]$$

$$J = Q.N.v_d \quad [A/m^2]$$

Logo:

$$v_d = \text{constante} \times E$$

Essa constante, $\sigma / Q.N$, é conhecida como MOBILIDADE μ [$m^2/V.s$]

Podemos reescrever J como:

$$J = Q.N.\mu.E \quad [A/m^2]$$

E a condutividade como:

$$\sigma = Q.N.\mu \quad [\Omega/m]$$

Atividade

Condutividade e Mobilidade

Dado que $\sigma = Q \cdot N \cdot \mu$, qual o valor de ρ para um material semicondutor que tem lacunas p e elétrons livres n?

a) $\frac{1}{q(n + p)\mu}$

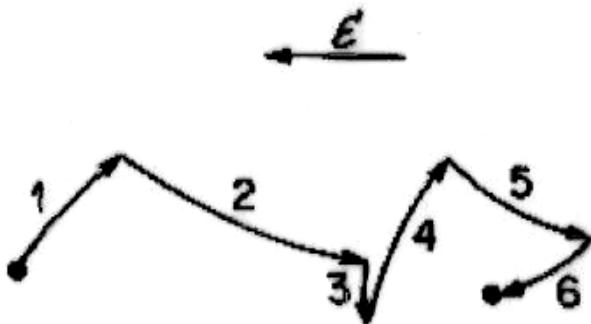
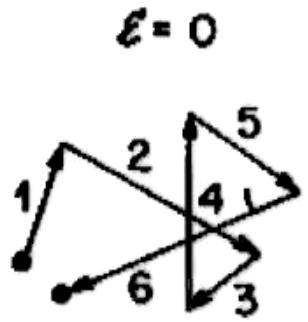
b) $\frac{1}{q(-n \cdot \mu_n + p \mu_p)}$

c) $\frac{1}{q(n \cdot \mu_n - p \mu_p)}$

d) $\frac{1}{q(n \cdot \mu_n + p \mu_p)}$

e) Não tenho certeza

Velocidade de Deriva e Velocidade Térmica



$$v_{th} = \left(\frac{8kT}{\pi M} \right)^{1/2} \text{ [m/s]}$$

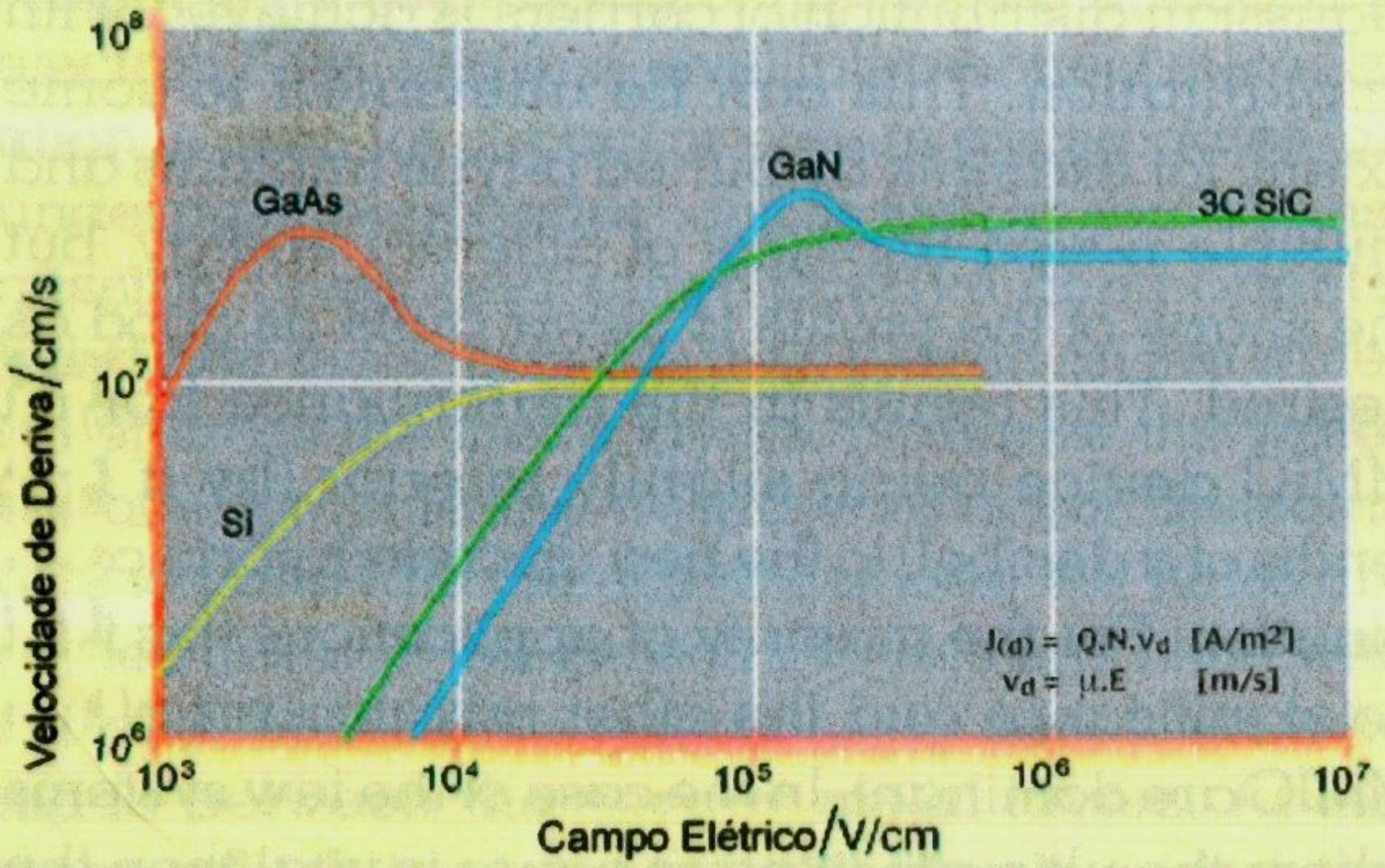
10⁵ m/s a 300K

ou 0,026 eV

para elétrons em Si
 $\mu \approx 0,1 \text{ m}^2/(\text{V.s})$

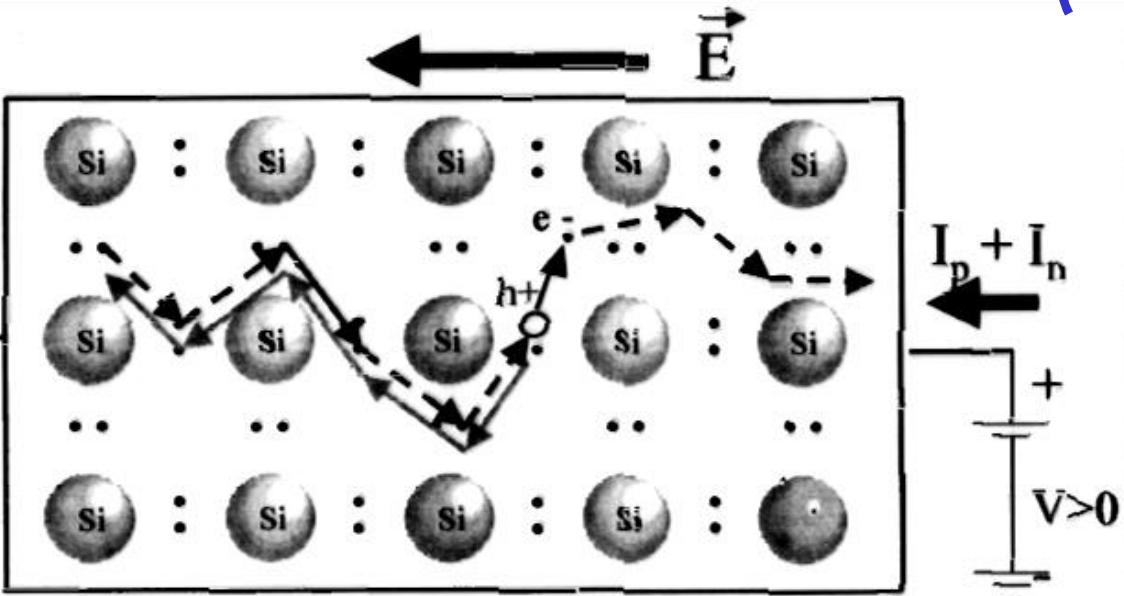
$$v_d = \mu \times E$$

$$v_d \ll v_{th}$$



Velocidade de deriva dos elétrons para arseneto de gálio, silício, nitreto de gálio e carbeto de silício

Mecanismos de Condução de Corrente em Semicondutores: Deriva (Drift)



$$v_{p\text{-der}} = \mu_p E$$

$$J_{p\text{-der}} = qp\mu_p E$$

$$I_{p\text{-der}} = q \cdot A \cdot p \cdot \mu_p \cdot E$$

$$I_{T\text{-der}} = I_{p\text{-der}} + I_{n\text{-der}} = q \cdot A \cdot E \cdot (p \cdot \mu_p + n \cdot \mu_n)$$

$$v_{n\text{-der}} = \mu_n E$$

$$J_{n\text{-der}} = qn\mu_n E$$

$$I_{n\text{-der}} = q \cdot A \cdot n \cdot \mu_n \cdot E$$

Resistividade:

$$\rho = 1/[q(p\mu_p + n\mu_n)]$$

μ_p e μ_n = mobilidade das lacunas e elétrons respectivamente.
 $(\mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{V.s}, \mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{V.s})$

Relação de Einstein:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = V_T$$